



型号 2001 洁净室超纯喷雾器™ 是便携式烟雾产生工具。它为半导体和制药设备产生非常密集，明显的烟雾来显现空气流量，湍流和速度，且之后没有留下任何残渣，也不需要清洁。传统的 DI 水喷雾器使 DI 水和其它杂质粉碎成大的低密度的 5 到 10psi 输出压力的水滴；而超纯喷雾器提供今天洁净室烟雾产生的达 4 倍大的体积，更高的烟雾密度，最高的纯度和最低输出压力。

纯度是通过把去离子水煮沸制造水蒸气，同时利用重力和电气接地来去除蒸汽中的 DI 水残渣和细菌试剂。然后纯蒸汽经过在常温沸腾的 LN2 池。大量的水分子和氮分子在淬火过程中结合产生出大容量，非常明显的超纯烟雾。出口温度大约是 80 华氏度。当烟雾进入气流中温度轻微上升，然后快速冷却到周围的气流温度。

由于出口压力小于 0.3 psi，超纯烟雾有出口的湍流。超纯烟雾留下了最小的痕迹残留；因此可用于从等级 1 到 10000 级的洁净环境，且使用后无需清理。雾会蒸发成气态的氢，氧和氮，不会污染环境。高密度烟雾增加了烟雾的持续时间和蔓延距离。外壳是一个耐摔的白色粉末层。



超纯烟雾运用在半导体和制药环境中来显现围绕装备，工具走廊，入口和操作员的气流形态。它也用来找出可能传输空运污染物到重要工作区域的固定漩涡的位置。它被用来追踪气流方向和速率来确保从洁净室隔间到邻近的装备槽的相同的流动分割，并且侦查不必要的空气渗透到洁净室的情况。



超纯喷雾器用在制药工序上来证明过程环境都管理得很恰当，根据美国 FDA 的要求；以大大减少清洁工作和污染物代替过去在制药环境中采用的烟雾棒。

半导体和制药用途的超纯洁净室喷雾器

1. 提供很密集的烟雾，在 30-50%温湿度的典型的环境气流中持续得更久
2. 几乎零含量的剩余污染物在气流中传送给类别 1 到 10000 使用
3. 以非常低的输出压力提供大体积的纯净烟雾，带来最小输出湍流
4. 代替制药烟雾棒；减少清洁工作和污染物
5. 无可移动零件，因此提供了非常高的可靠性

规格

	型号 2001
烟雾持续时间	50-60 分钟
烟雾体积	15 cfm
烟雾类别	超纯
LN2 杜瓦容量	9 升 (8.5Qts)
DI 水锅炉容量	3 升 (2.8Qts)
尺寸 (W×D×H)	53.3×38.1×40.6 厘米, 21"×15"×16"
重量 (全部)	25 公斤, 55 磅
配件 (包括)	9 英尺水管, 软管, 喷雾流, 烟雾耙

代理商



广思科技
QUEST TECHNOLOGY

网站: www.quest-tech.com.cn

电话: 86-21-58397708/86-21-58397706/
86-21-68640335

传真: 86-21-58397825